

規格品装置

スパッタ装置

Sputtering Systems

多元スパッタ・同時スパッタを実現する
研究用スパッタ装置の決定版。

- 研究・開発に適したエコノミータイプ
- コンパクトで低価格
- 多元スパッタ、同時スパッタが可能（オプション）

用 途

- 電池材料
- 光学薄膜
- マイクロマシン
- 磁性薄膜
- ガスバリア膜
- 各種合金薄膜
- 透明導電膜



SR-350DS-31-N標準仕様

ス パ ッ タ 室	●円筒側面開閉式真空チャンバ 寸 法：約φ350×D270 材 質：SUS304 ●到 達 圧 力 5×10^{-5} Pa以下 ●の ゑ き 窓 ●ガ ス 導 入 系 ●カソード電極取付ポート×3 ●予 備 ポ ー ト
電極・サブストレート	●基 板 寸 法 ウエハφ3インチ ●カ ソ ー ド 電 極 3インチマグネトロン×1 (合計3個まで増設可能) ●サブストレートホルダ モータ回転式3～30rpm 平面タイプ(水冷) ●成 膜 速 度 60nm/min (AL) ※ターゲット — 基盤間距離=70mm ●膜 厚 分 布 φ60の範囲で±10% ※ターゲット — 基盤間距離=70mm
真 空 排 気 系	●排 気 ユ ニ ッ ト 高真空排気装置 DS-412Z 油拡散ポンプ、油回転ポンプ、液体窒素トラップ ●真 空 計 広域電離真空計、ピラニ真空計
電 気 系	●高 周 波 電 源 300W 13.56MHz AC200V ●マッティングボックス 手動3点切替器
安 全 対 策	●断 水 リ レ ー
ユ ー テ ィ リ テ ィ	●設 置 寸 法 約W2200×D1300×H1500 (mm) ●Ar ガ ス 5～30kPa ●冷 却 水 0.13～0.15 MPa 6L/min ●電 源 容 量 3φ 200V 4.2kVA
オ プ シ ョ ン	●マルチカソード電極 3インチマグネトロンを2個増設可能 ●R F 電 源 切 替 器 ●D C 電 源 ●逆スパッタ機構、バイアススパッタ機構 ●基板位置決め機構 ●基 板 加 熱 機 構 ●マスフローコントローラ 2系列 ●ターボ分子ポンプ

※2インチ、4インチターゲットも可能です。

※上記以外の仕様については、ご相談ください。

※外観・仕様については改善のため予告なく変更する場合があります。

大亜真空株式会社

DIAVAC LIMITED

本社営業部／〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-7628 FAX.047-459-3654

西日本営業所／〒665-0052 兵庫県宝塚市新明和町1-1
新明和工業株式会社 産機システム事業部内
TEL.0798-54-1869 FAX.0798-54-1881

本社・工場／〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-5311 FAX.047-459-3628

<https://www.diavac.co.jp>

特約店